

【公報種別】特許法第 17 条の 2 の規定による補正の掲載

【部門区分】第 2 部門第 1 区分

【発行日】平成24年10月4日 (2012.10.4)

【公開番号】特開2012-157828(P2012-157828A)

【公開日】平成24年8月23日 (2012.8.23)

【年通号数】公開・登録公報2012-033

【出願番号】特願2011-19970(P2011-19970)

【国際特許分類】

B 0 5 D 5/12 (2006.01)

C 0 9 D 5/25 (2006.01)

C 0 9 D 201/00 (2006.01)

C 0 9 D 1/00 (2006.01)

C 0 9 D 7/12 (2006.01)

H 0 1 B 17/60 (2006.01)

【F I】

B 0 5 D 5/12 D

C 0 9 D 5/25

C 0 9 D 201/00

C 0 9 D 1/00

C 0 9 D 7/12

H 0 1 B 17/60 A

【手続補正書】

【提出日】平成24年7月30日 (2012.7.30)

【手続補正 1】

【補正対象書類名】特許請求の範囲

【補正対象項目名】請求項 2

【補正方法】変更

【補正の内容】

【請求項 2】

前記成形体を成形する工程は、基材の表面に、含浸後の前記コア／シェル粒子を被覆することにより、前記基材表面に前記成形体として絶縁被膜を成形する工程であることを特徴とする請求項 1 に記載の絶縁樹脂材料の製造方法。